PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-064442

(43)Date of publication of application: 05.03.1999

(51)Int.CI.

GO1R 31/26 GO1R 31/28

(21)Application number: 09-241981

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

21.08.1997

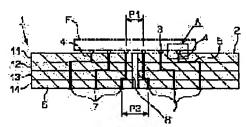
(72)Inventor: KAWAGUCHI KENZO

(54) JIG FOR ELECTRONIC COMPONENT CHIP INSPECTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a jig capable of performing the electric inspection by a flip chip single body before loading to a wiring board, without disturbing repetitive use in the performance inspection of a flip chip.

SOLUTION: Many electrodes 3 for the inspection for bringing the connection terminal of an electronic component chip F into contact are formed on an insulation substrate and the electrodes 3 for the inspection are connected to the separately provided electrodes 7 through internal conductor wiring. Hard Cr plating for which hardness is about Hv500-1,000 is applied to a surface for the electrodes 3 for the inspection and this jig for the inspection is attained. It is connected through the separately provided electrodes 7 to a prescribed inspection device, and the bump of the chip F is positioned to the respective electrodes 3 for the inspection, brought into press-contact and conducted. Thus, the electric inspection is performed by the chip single body before loading to the wiring board.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.08.1998

[Date of sending the examiner's decision of

16.01.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-64442

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

(51) Int.Cl.⁶

G01R 31/26

31/28

體別記号

FΙ

G01R 31/26

31/28

J K

審查請求 有 請求項の数5 FD (全8頁)

(21)出題番号

特顯平9-241981

(22)出顧日

平成9年(1997)8月21日

(71)出題人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72)発明者 川口 健議

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊

陶業株式会社内

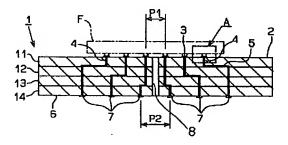
(74)代理人 弁理士 加藤 和久

(54) 【発明の名称】 電子部品チップ検査用治具

(57)【要約】

【課題】 フリップチップの性能検査において、繰返し 使用に支障がなく、配線基板への搭載前にフリップチッ ブ単体でその電気検査ができる治具を得る。

【解決手段】 電子部品チップFの接続端子Tを接触さ せる検査用電極3を絶縁基板上に多数形成する。その検 査用電極3は、内部の導体配線を介して別設の電極7に 接続する。検査用電極3は表面に硬度がHv500~1 000程度の硬質Crメッキをかけておき、検査用治具 とする。別設の電極7を介して所定の検査装置に接続 し、各検査用電極3にチップFのパンプTの位置を合わ せて圧接し、導通をとる。これにより配線基板への搭載 前にチップ単体で電気検査できる。



【特許請求の範囲】

【 請求項 1 】 電子部品チップの電気検査を行うために その接続端子を接触させる検査用電極が一主平面上に絶 縁を確保して多数形成されていると共に、その検査用電 極は、内部の導体配線を介して別設の電極に接続されて なり、しかも、前記検査用電極は表面に硬度がHv50 0以上の硬質メッキがかけられていることを特徴とする 電子部品チップ検査用治具。

【請求項2】 前記検査用電極が絶縁基板の一方の主平 面に設けられていると共に、前記別設の電極が該絶縁基 10 板の他方の主平面に前記検査用電極相互の間隔よりも大 きい間隔で設けられていることを特徴とする請求項1記 載の電子部品チップ検査用治具。

【請求項3】 前記絶縁基板がセラミック多層配線基板 からなることを特徴とする請求項2記載の電子部品チッ プ検査用治具。

【請求項4】 前記検査用電極が設けられている一主平 面に、電子部品チップの位置決め用マークが形成されて いることを特徴とする請求項1、2又は3記載の電子部 品チップ検査用治具。

【請求項5】 一端が、前記一主平面であって前記検査 用電極群の中央寄り部位において開口する貫通孔が設け られていることを特徴とする請求項1、2、3又は4記 載の電子部品チップ検査用治具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品チップ検 査用治具に関し、詳しくは、外部接続端子(以下、接続 端子又は単に端子ともいう)を一主平面に多数備え、フ 搭載、接続されるIC等の電子部品チップ(以下、フリ ップチップ又はチップともいう)について、その性能検 査(以下、電気検査ともいう)をする際に使用される検 査用治具(以下、単に治具ともいう)に関する。

[0002]

【従来の技術】ワイヤボンディングタイプの【Cチップ では、その電気検査はチップの全接続端子に同時にプロ ーブを当接ないし圧接させることで、問題なくこれを行 うことができる。端子にはワイヤボンド可能なように平 坦面が形成されているからである。また、TAB(Tape 40 Autonated Bonding) タイプのチップでは、チップをT ABテープに接合した後、TABテープ上に形成された テストパターンを利用してチップの電気検査を行うこと ができる。このように、フリップチップ以外のチップで はチップ単体で性能検査ができる。したがって、これら のチップではチップ単体で合否(測定結果)を判定し、 その合格品(良品チップ)のみを1Cパッケージなどの 配線基板(以下、単にパッケージ或いは配線基板ともい う) に搭載することができる。

【0003】一方、フリップチップの電気検査は、従

来、これをパッケージに搭載、接合した後に行ってい た。フリップチップでは、その一主平面に設けられた外 部接続端子(電極)がバンプをなし、これが格子状など 平面的に多数配置されているので、すべてのパンプを一 括してプロービングするように多数のブローブを1つの 装置として組み立てることが困難なためである。このよ うに、フリップチップにおいては他のチップのようにブ ロービングができず、チップ単体での性能測定(合否の 判定)はできないため、チップをパッケージに搭載、接 合した後に、そのパッケージのプリント基板接続用の外 部用の電極を検査装置を構成するテストボードの電極に 圧接するなどにより電気的導通を確保し、その下で電気 検査をしていた。とのような搭載後の電気検査によれ ば、質の高い検査となる反面、次のような問題があっ た。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】すなわち、パッケージ に搭載した後、不良と判定された場合には、不良チップ の他にそのパッケージをも廃棄することになってしま う。したがって、搭載工程やパッケージに無駄が生じる といった問題があった。また、再リフローすることで接 合を解除して不良チップを取り除いてパッケージを回収 し、別のチップをその回収したバッケージに搭載すると とも考えられる。しかし、これでは再リフローして不良 チップをパッケージから除去する手間がかかる上に、前 に接合した際のハンダや金などの残渣がバッケージのバ ッド上に残るので、たとえ検査で合格となったとしても 装置としての信頼性の低下を招く原因となる。また、不 良判定が繰り返されれば、チップの搭載、接合およびそ リップチップ方式にてICバッケージなどの配線基板に 30 の除去の繰り返しを要するだけでなく、こうした問題は 一層顕著となる。

> 【0005】一方、とのような問題の解消のためには、 検査対象のチップが搭載される配線基板と同一のものを 治具として使用し、チップの端子をハンダ付けすること なく配線基板の端子に当接ないし圧接させることで導通 を確保し、その下でチップの電気検査をする、といった ことが考えられる。しかし、例えばセラミック製パッケ ージではその端子は厚膜メタライズからなり、通常、そ の表面には軟質のNiメッキ及び軟質のAuメッキがか けられており、その硬度はHv(ビッカース硬度)50 ~200程度と低い。

【0006】 このような低硬度の軟質メッキがかけられ た端子にチップの端子を繰り返し当接ないし圧接すれ ば、その端子の表面層(メッキ)が早期に摩耗してしま い、少数チップ(数十個~数百個程度)の検査をした段 階で導通不良を招いてしまう危険性が高い。一方で、チ ップの一か月当たりの生産数は百万個単位である。した がって、パッケージそのものを検査用治具として用いる ためには、検査の信頼性を低下させないように検査過程 50 でそれを頻繁に交換せざるを得ないが、これではコスト

の増大や検査効率の低下を招くことは明らかであり、実 用化できない。

【0007】本発明は、フリップチップの性能検査にお けるとのような問題点に鑑みて成されたもので、その目 的とするところは、多数のチップの電気検査に支障がな く、配線基板への搭載前にフリップチップ単体でその電 気検査を行うのに好適な電子部品チップ検査用治具(以 下、単に治具ともいう)を提供することにある。 [0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた 10 めに本発明の電子部品チップ検査用治具は、電子部品チ ップの電気検査を行うためにその接続端子を接触させる 検査用電極が、一主平面上に絶縁を確保して多数形成さ れていると共に、その各検査用電極は、内部の導体配線 を介して別設の電極に各々接続されてなり、しかも、前 記各検査用電極は表面に硬度(ビッカース硬度)がHv 500以上の硬質メッキがかけられていることにある。 そして、ことに硬質メッキには、硬質Cr、硬質Au、 パラジウム、ロジウムの各メッキが例示される。

【0009】上記検査用治具においては、その別設の電 20 極を、チップ検査装置を構成するテストボードの各端子 にハンダ付けなどにより接続し、検査装置に組込んで電 子部品チップ検査装置を構成する。そして、治具の検査 用電極に検査対象とされるフリップチップの各接続端子 (ハンダバンブなど)の位置を合わせ、所定の力で同電 極と同端子間が圧接されるようにする。こうすること で、チップの接続端子と治具の検査用電極とが導通し、 フリップチップについて必要な電気検査をすることがで

以上の高硬度の硬質メッキがかけられている。一方、チ ップの接続端子はハンダバンブ、Auバンブなどであ り、その硬度は高くともHv50以下である。このよう な硬度の差により、多数のチップを検査することによっ てその接続端子 (ハンダバンプなど) が対応する治具の 検査用電極に繰り返し接触しても、その検査用電極の摩 耗は実質的に発生しないか微量である。これにより、本 発明に係る治具においては、数万個単位の多数のチップ の検査にも実用上問題なく使用できる。

【0011】かくして、本発明に係る検査用治具によれ 40 ば、フリップチップにおいても各種の電気検査がチップ 単体でできることになる。しかも、本発明にかかる治具 は、チップを搭載するパッケージと実質的に同じもので 構成でき、かつその接続端子に硬質メッキをかけること で構成(製造)できるから、治具自体の製造も容易であ る。さらに、チップがパッケージに搭載された場合とま ったく同一の条件での電気検査ができるから、従来と同 様に検査の質を高めることができる。

【0012】そして、上記手段においては、前記検査用 電極が絶縁基板の一方の主平面に設けられていると共

に、前記別設の電極(相互間隔)が該絶縁基板の他方の 主平面に前配検査用電極相互の間隔よりも大きい間隔で 設けられているのが好ましい。別設の電極から各種の検 査機器への接続が容易となるからである。

【0013】また、絶縁基板は、セラミック基板とし、 前記一主平面をなす表面を研磨によって平坦にしておく のが好ましい。研磨によって、高精度に平坦化できるの で、接続がより確実となるためである。基板の大きさに もよるが、平面度は、10μm以下であり、表面粗さは $Ra:0.8\mu m以下とするのが好ましい。とくに、セ$ ラミック基板はセラミック多層配線基板であるとよい。 基板内において、検査が容易なように内部の導体配線 (内部配線ともいう)を引き回して別設の電極に取り出 すことができるためである。

【0014】さらに、上記治具においては、検査用電極 が設けられている一主平面側にチップの位置決め用のマ ーク(穴やメタライズ層)を形成しておくとよい。この ようなマークが設けられていれば、これを読み取ること で治具の検査用電極に対するチップの端子の位置決めが でき、したがって、チップの実装時と同様に位置決めが できる。なお、このようなマークは、治具の検査用電板 が設けられている一主平面側において、その外周寄り部 位に3か所以上に分離して設けるのが適切である。

【0015】そして、上記のいずれの治具でも、一端 が、前記一主平面の前記検査用電極の群の中央寄り部位 に開口する貫通孔を設けるとよい。このようにしてあれ ば、検査時において、電子部品チップを位置決めし、そ の下で、同貫通孔の他端の開口から真空引きすることで 同チップを吸着できるので、検査時におけるチップの移 【0010】そして、検査用電極の表面にはHv500 30 動防止ないし固定を容易にできるためである。なお、賞 通孔は、治具が絶縁基板からなるものでは、その他端の 開口は検査用電極が設けられている側の主平面と反対側 の主平面とされるのが好ましいが、その他端の開口位置 は治具の構造により適宜に設定すればよい。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態例について、 図1~3を参照して詳細に説明する。図1ないし図3 は、本発明にかかる治具1の一実施形態例を示すもので ある。この治具1は、フリップチップが搭載されるLG Aタイプのセラミック製配線基板と同様の平板形状、積 層構造を成し、次のように構成されている。ただし、本 例では詳しくは後述するがアルミナセラミックを主体と して同時焼成されてなるものである。

【0017】すなわち、本例の治具1は、上部の平坦な 表面(一主平面)2が図2に示したように、検査対象と されるフリップチップFの載置面とされており、各検査 用電極3,3が、平面視において同チップFの各接続端 子と対面するように、それと同じ微小なピッチP1、配 置で絶縁を確保し、治具1の表面2上に、縦横に多数形 50 成されている。この検査用電極(群)3は、▼(タング ステン) やMo (モリブデン) などの高融点金属を主成 分とするピア4や内部の導体配線5を介し、治具1の下 部表面(下面)6に導出され、検査用電極3相互間の間 隔(ピッチ)P1より大きな間隔P2で配置された別設 の検査装置接続用の電極7、7にそれぞれ接続されてい る。本例のように、との電極7,7の間隔P2を大きく しておくと、この治具1を各種の電気的特性を検査する 検査装置において用いる場合に接続や配線が容易とな

【0018】さて、このような本例治具1は、複数のセ ラミック層11~14を積層、焼結してなると共に(図 2参照)、図3に示したように、表面2すなわち最上層 のセラミック層 1 1 の上面 1 1 a に、各ピア 4 の上端に 形成された検査用電極3が形成されている。すなわち、 詳細な製法は後述するが、本例では最上層のセラミック 層11の上面11aは所定の平面度(10μm程度)、 表面粗さ(Ra:0.5 μm)となるように焼成後研磨 され、その上面11aの各ピア4の部位に所定の平面形 状(本例では円形)、厚さの平坦な検査用電極3を備え ている。

【0019】このような検査用電極3の外径D1は例え ぱ120μmとされ、検査対象のチップFのハンダバン プ(端子) Tの基端部の径と略同一に設定されている。 また、検査用電極3は、後述するように形成され、最表 面に本例では硬質Crメッキが厚さ1~10μmかけら れ、その硬度がHv500~1000に確保されてい る。なお、検査用電極3の厚さ(検査用電極3の上面3 aからセラミック層11の上面11aまでの高さ)は5 ~20μm程度に設定されている。

【0020】また、治具1の表面2の中央寄り部位であ ってチップFが搭載されて重ねられる図1中2点鎖線で 示されるチップ搭載エリアEには、治具1の厚さ方向に 貫通する貫通孔8が2か所設けられている(図1及び2 参照)。ただし、その直径は1~2mm程度とされてい る。さらに、本例では、フリップチップを搭載する表面 2には検査用電極3と同材質からなる位置決め用マーク (フィディシャルマーク) 9が表面2の外周寄り部位に 複数(本例では4か所)設けられている。このように本 例の治具1は、貫通孔8の存在と検査用電極3の最表面 ク製のLGA配線基板とほぼ同様のものである。

【0021】とのような本形態例の治具1を用いてチッ プの電気検査をする際には、図4に示したように、その 治具1の外部用の電板7を所定のテストボード201の 各端子(図示せず)にハンダ付けなどにより接続し、リ レー202、半導体パラメータアナライザ203、コン トローラ204などを含む所定のチップ検査装置210 に組込み、その下で、検査対象のフリップチップFを治 具1にセットすることで必要な電気検査をすることがで きる。なお、本例では、治具1の表面2に搭載、セット 50 に、ハンダバンブの変形は、その高さの2~50%の範

されたチップFをその貫通孔8を介して同図中矢印Vで 示したように真空引きして治具1の表面2に吸着するよ うに、テストボード201には貫通孔8に対応する位置 に吸引用の管路Kが形成されている。そして、治具1の 下面6の外周寄り部位とテストポード201との間には シール材(図示せず)が介装されて気密が保持されてい

【0022】本例治具1をこのように検査装置に組込ん でチップFの検査をするに当たっては、治具1にチップ Fを搭載する際、治具1の4つの位置決め用マーク9の 位置を読取る。この読取りに基づいて各検査用電極3の 位置を検出し、その検出位置にチップFの各パンプTが 正対するようにチップFの位置を修正しながら治具1の 表面2上に正しくセット(載置)し、各パンプTが検査 用電極3に当接するようにする。次いで、矢印Vに示さ れるように貫通孔8を介してチップFを真空引きする。 すると、チップFは治具1に所定の力Pで吸着され、チ ップFの全バンプTの頂部(先端)が各検査用電極3に 圧接される。こうして、チップトのハンダバンプTと治 20 具1の検査用電極3との導通が確保される結果、チップ Fの電気検査はワイヤボンディングタイプのものやTA Bタイプのものと同様、本例の治具1を介して配線基板 への搭載前にそれ単独で行うことができる。

【0023】この際、本例治具1においてはその検査用 電極3の表面にHv500~1000といった高硬度の 硬質Crメッキがかけられているから、検査用電極3が 摩耗することなく、数万個単位の多数のチップを問題な く検査することができる。すなわち、本例の治具1によ り、検査用電極3の摩耗を招くことなくパンプTとのプ ロービィングが可能となるため、従来実現できなかった チップ単独での電気検査が可能となり、その検査効率の 格段の向上が図られる。しかも、本例治具1は、チップ Fが搭載されるパッケージと同一のものを利用し、追加 的な加工をすることで形成できるから、チップが実際に 搭載される場合と同一条件での電気検査が低コストで実 現できる。

【0024】なお、この検査ではチップFのハンダバン プTは、真空引きすることで頂部がやや圧縮変形する が、その変形が過剰とならないように、図5に示したよ の硬質メッキを除くと、その材質、構造とも、セラミッ 40 ろに、治具1の表面2とチップFとの間に、ハンダバン ブTの高さの許容最小高さ(又はこの許容最小高さと検 査用電極3の厚さを加えた高さ)よりやや小さい所定の 厚さTaをもつ間隙保持部材(間隙保持手段)Gを介在 させてもよい。すなわちこのような間隙保持部材Gを介 在し、治具1の表面2とチップFとの間隙が一定に保持 されるようにれば、チップFが治具1に載置(セット) されて吸着され、バンプTの頂部が圧縮変形する際で も、バンブの高さはその間隙保持部材Gの存在により、 その厚さTaより小さくなることが防止される。因み

囲が適切である。変形が2%より小さいと、バンブと検 査用電極との接触圧力が小さくなり、両者間の接触抵抗 が不安定になりやすいし、50%を超えるようだと変形 (潰れ)も大きく、後工程でのパッケージとの接続に支 障が生じるためである。

【0025】また、本例では検査用電極3とバンプTと の電気的導通を確保するため、治具1に貫通孔8を設 け、これを介してチップFを治具1の表面2側に真空引 きして吸着、固定することとしたが、本発明にかかる治 具ではこのような貫通孔8は必須のものではない。すな わち、その電気的導通は、チップFの自重やそれに錘を 載せることなどによっても確保できるからである。さら に、本例では治具1の検査用電極3に対するチップFの バンプTの位置決めをするために、治具1の表面2に位 置決め用マーク8を形成したが、本発明にかかる治具で はこのような位置きめ用マーク9は必須のものではな い。とのような位置決めは、治具1の検査用電極3にチ ップのバンプTが正しく対応すればよく、他にも適宜の 手段を用いることができるためである。例えばチップ搭 載エリアEに外接するようにガイド部材(図示せず)を 20 立設し、これにチップの側縁を内接させるようにして位 置決めするとともできる。

【0026】さて、次にとのような治具1の製法例につ いて説明する。まず、セラミック積層タイプのLGA配 線基板を作るのと同様にして図6に示したようなセラミ ック基板 10を次のようにして製造する。アルミナを主 成分とするグリーンシートに検査用電極位置を含め、ビ アホールを設け、タングステン、モリブデンを主成分と するメタライズインクを充填し、スクリーン印刷法にて 電気回路バターンを形成し、さらに、真空引用の貫通孔 30 を開ける。以上の加工を施したグリーンシートを所定枚 数分、積み重ねて積層加工する。そして、下面6の電極 7位置にメタライズインクを塗布しその後、所定温度で 還元雰囲気中にて同時焼成する。とうして、図6に示し たような検査用電極用のピア4や内部配線5さらには真 空引用の貫通孔8を備えたセラミック基板10をつく る。このセラミック基板10は多層配線基板となってい るので、内部配線5の引き回しが容易であり、間隔P22 が大きくされた検査装置用の電極7へ容易に接続でき る。

【0027】次にとのような基板10に検査用電極3及 び位置決め用マーク9を形成する手法について説明す る。ただし、両者は検査用電極3がピア4の上端部に形 成されるのに対して位置決め用マーク9がこのようなビ アと関係なく基板10の外周寄り部位の表面に形成され る点が相違することを除けば、同一断面構造であり同一 工程で形成できるため、以下においては検査用電極の形 成についてのみ説明する。すなわち、図7-Aに示した ように、検査用電極を形成する基板10の最上層のセラ ミック層11の表面11aを要求される平面度(例えば 50 ストを印刷しておくとともに、同マークが形成されたセ

10 μm) および表面あらさ (Ra: 0. 5 μm) とな るように研磨し、ピア4の端面4aを基板表面11aに 露出させる。焼成によって形成されたセラミック基板1 0は若干反り、うねりを有していることが多いが、セラ ミック基板10の表面11aを研磨して平面とすること で、検査用電極が平面度の高い平面上に形成でき、チッ ブのバンプとの接続性が良好となる。

【0028】その後、図7-Bに示したように、その表 面11aの全面にセラミック基板10との密着性のよい TiをO. 2 µm程度の厚さにスパッタリングし、その 上に、Cuを0.5μm程度の厚さにスパッタリング し、Ti層51、Cu層52を形成する。次いでその上 にレジスト(感光性樹脂)53を塗布し(図7-C参 照)、露光・現像して検査用電極の形成部分を開口させ る(図7-D参照)。なお、この際には位置決め用マー クの形成部位も開口させる。

【0029】次に、その検査用電極部位(及び位置決め 用マーク部位) にCuメッキを厚さ3μm、Niメッキ を厚さ1μm程度かけ、Cu層54、Ni層55を形成 し、最後に所定の硬度(例えばHv500~1000) となる硬質Crメッキを厚さ1~5 µm程度かけ、最表 面に硬質メッキ層としてCr層56を形成する(図7-E参照)。そして、レジスト53を剥離し除去する(図 7-F参照)。さらに、基板表面11a上のTi層5 1、Cu層52を所定のエッチング液でエッチングして 除去すると、図7-Gに示したように、基板表面11a には、Ti、Cu、Cu、Niさらには硬質Crの各層 からなる検査用電極(パッド)3及び位置決め用マーク (図示せず)が形成される。

【0030】なお、上記の形態例においてこのような位 置決め用マークを設けず、しかも要求される検査用電極 3の面積(直径)が小さい場合には、このような手法に よることなく、基板表面11aに、露出しているピア4 の端面4 a に、表面11 a の研磨後、或いは研磨すると となく直接、Niメッキをかけ、その上に硬質Crメッ キをかけることで表面に硬質メッキをかけてなる検査用 電極としてもよい。

【0031】因みに、このようにピア4の端面4aに直 接、Niメッキ、硬質Crメッキをかけるような場合に 40 おいて位置決め用マークを設ける場合には、次のように 設けるとよい。すなわち基板表面11aを研磨しない場 合には、最上層のセラミック層をなすグリーンシートの 上面に位置決め用マークのためのメタライズペーストを 印刷しておき、同時焼成後、同マークにも検査用電極と 同時にメッキをかけるのである。また、基板表面11a を研磨する場合には、位置決め用マークの上面が基板1 0の表面11aより低位となるように、その表面11a を形成するセラミック層11よりも下のセラミック層 (グリーンシート) の上面にマーク用のメタライズペー

ラミック層より上のセラミック層に、同マークが露出す るように開口を設けておき、積層、焼成するのである。 とのようにしておけば、研磨しても同マーク用のメタラ イズが消失しないためである。

【0032】上記形態例では、検査用電極3の表面の硬 質メッキとして硬質Crメッキをかけたが、本発明にお ける硬質メッキは、もちろんこれに限定されない。すな わち、Hv500以上あり、多数のチップを検査しても 検査用電極の摩耗がないものであればよく、この他パラ ジウム、ロジウム、硬質Auの各メッキが代表的なもの 10 気的に行う装置であれば、いずれの装置においても使用 として例示される。なお、このような硬質メッキも、図 7-EにおけるNiメッキの後にかけ、その後でレジス ト53を剥離し、表面のCu層52、Ti層51をエッ チングにより除去すればよいが、これに限定されるもの ではない。治具を形成する絶縁材が樹脂であり検査用電 極がCuである場合には、その上にNiメッキ及び硬質 Crメッキをかけてもよいし、検査用電極の素地(C u) の上に直接硬質Crメッキをかけてもよい。なお、 このような硬質メッキは複数層かけてもよいことはいう とするのが好ましいが、メッキの種類や硬度或いは必要 な耐摩耗性などに応じて適宜に設定すればよい。

【0033】上記では、フリップチップに接続端子とし てハンダバンブが形成されているものを検査する治具と して説明したが、Auバンブが形成されているチップを 検査する治具としても使用できることは明らかである。 バンプの種類や形成方法に応じてその形状、大きさが異 なることから、検査用電極のピッチ、大きさは、バンブ のそれらが正しく対応するように適宜に設計すればよ いい

【0034】なお、上記においては治具の材質、構造 を、LGA配線基板と同様のセラミック多層配線層構造 の平板形状としたが、本発明に係る治具においては、そ の材質、構造ないし形状は上記のものに限定されるもの ではない。セラミック以外の適宜の絶縁材(例えば樹 脂)で、適宜の構造、形状のものとして具体化できる。 要求される平面度、表面粗さが確保されるように、適宜 の材質、構造を選定すればよい。さらに、検査用電極の 平面形状は円形に限定されるものではない。

【0035】また、治具における検査装置との接続用の 40 別設の検査装置接続用の電極は、検査対象のチップの載 置面と反対側の主平面に形成したが、この位置は、治具 を平板形状とする場合でも、その側面に導出することも できるし、治具自体を十分大きくすれば検査用電極の形 成面と同一面に形成しても良いなど、治具の形態、構造 に応じ、さらには治具が接続される検査装置側のテスト ボードなどに応じて適宜に設計すればよい。そして、検 査装置との接続用の電極の形態は、上配においてはLG A配線基板と同様の電極(パッド)としたが、このよう な電極にピンをロー付けしてPGA(ピングリッドアレ 50

イ) 配線基板と同様の構造にしておき、検査装置側のテ ストボードなどへの接続をブラグイン方式としておいて もよい。

10

【0036】なお上記においては、本発明の治具を用い たフリップチップの検査装置として、半導体パラメータ アナライザによる検査を行う装置を例示したが、本発明 の治具はこれ以外の装置にも用いることができる。フリ ップチップの各種の電気的特性や論理的動作の検査等、 フリップチップ単体での特性の検査をバンプを介して電 できる。本発明は、上記の形態例に限定されるものでは なく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々、設計 変更して実施できる。

[0037]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 に係る電子部品チップ検査用治具によれば、多数のチッ ブの電気検査にも支障がない。しかも、配線基板への搭 載前にフリップチップ単体でその電気検査を行うことが できる。したがって、検査効率が格段と向上する上に、 までもない。また、硬質メッキの厚さは、なるべく厚め 20 パッケージの歩留まりの向上と共にチップの搭載工程の 無駄がなくなり、ひいてはIC装置の信頼性の向上も期

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る電子部品チップ検査用治具の一実 施形態の概略構成斜視図。

【図2】図1の拡大断面図。

【図3】図2におけるA部拡大図。

【図4】図1~3の電子部品チップ検査用治具を用いた フリップチップ検査装置の説明図及びその検査の状態の 30 説明図。

【図5】治具の表面とチップとの間に間隙保持部材を介 在させた図。

【図6】図1の治具をなすセラミック基板の断面図。

【図7】図1~3の治具の製造工程図。

【符号の説明】

- 1 電子部品チップ検査用治具
- 2 表面(主平面)
- 3 検査用電極
- 4 LT
- 5 内部の導体配線
 - 7 別設の電極
 - 8 貫通孔
 - 位置決め用マーク
 - 10 セラミック基板をなす多層配線基板
 - 11a セラミック基板の表面
 - F フリップチップ
 - T フリップチップのハンダバンプ(接続端子)
 - P1 検査用電極相互の間隔
 - P2 別設の電極の間隔

